Si ナノワイヤ及び極薄 SOI における UV ラマンスペクトルのサイズ効果

Size Effects in Ultraviolet Raman Spectra of Si Nanowires and Extremely Thin SOI

産総研-NeRI1, GNC-産総研2, ロシア熱物理学研究所3,

○多田 哲也 ', ウラジミール ポボロッチ ', 森田 行則 ², パベル・ゲシェフ ³,

AIST-NeRI¹, GNC-AIST², Institute of Thermophysics³, AIST⁴, Tetsuya Tada¹, Vladimir Poborchii¹, Yukinori Morita², Pavel Geshev³

E-mail: t-tada@aist.go.jp

【序論】

近年、超微細 CMOS においては、短チャンネ ル効果を抑制するため、厚さ数 nm 以下の薄膜 SOI (Silicon On Insulator)や、Si ナノワイヤ(NW)構 造の使用が検討されている。これらの、微細構造 に於いては、低次元化に伴うフォノンの量子閉じ 込め効果等による物性の変調が予想される。我々 は、前回、極薄 SOI のラマンスペクトルのサイズ/ 応力効果について報告した[1]。本講演では、Si NW のラマンスペクトルのサイズ効果の測定を行っ たので報告する。

【実験と結果】

使用した NW 試料は、(001) SOI 基板を用いて 作製した。SOI 基板は、SOITEC 製で、BOX (Buried Oxide)層は、145nm、SOI層は12nm およ び、7nm である。電子線リソグラフィーによりこれら の基板を加工し、幅 12nm、厚さ 12nm、及び、幅 9nm、厚さ7nmのNW 試料を作製した。ラマンスペ クトルは、364nm の励起光を用いた顕微ラマン分 光装置を用い、後方散乱配置で行った。測定温 度は、熱によるスペクトル幅の増大を避けるため、 77K で行った。また、比較のため、厚さ 3-70nm の SOI の測定も行った。

Siナノ構造のラマンスペクトルは、サイズがおお よそ 10nm より小さくなると、ピーク位置が低波数 側にシフトし、幅が広くなる。図1に NW 及び SOI のラマンスペクトルの低波数側へのシフト量($\Delta\omega$) を半値幅の増加量(ΔFWHM)の関数としてプロッ トしたグラフを示す。実線は、Richter-Campbell-Fauchet (RCF)モデルを用いて、Δω と ΔFWHM を

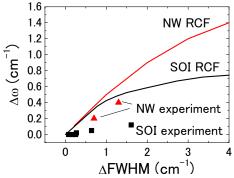


図1 ラマンスペクトルの線幅増加と低波数 シフトとの関係。

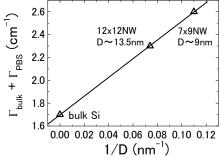


図2ラマンスペクトルの線幅増加とNW サイズの 関係。

計算した結果である。RCFモデルは、微細構造中 のフォノン閉じ込め効果で波数の選択則が緩和 する効果により、ピーク位置シフトと幅の変化を説 明するものである。グラフからから分かるように、 NW、SOI 双方とも実測値との一致はよくない。

これは、ラマンスペクトルの変化が、フォノン閉 じ込め以外の効果の寄与も無視できないことを示 している。そこで我々は、、フォノンが界面で散乱 される効果を取り入れて解析を行った。すなわち、 ラマンスペクトルの半値幅を

 $FWHM = \Delta FWHM_{conf} + \Gamma_{boundary} + \Gamma_{bulk}$ と表して解析を行った。ここで、 $\Delta FWHM_{conf}$ はフォ ノン閉じ込め効果による半値幅の増加量、 Γ_{boundary} は、界面散乱による幅、 Γ_{bulk} はバルクSiの自然幅

界面散乱による線幅は、Cashimir Limit により、 $\Gamma_{\text{boundary}} = v/2\pi cD$

で、77Kにおける値は、~1.7cm⁻¹である。

と書ける。vは音速、DはNWの断面積と同じ面積 を持つ円柱の直径に相当する長さ、c は光速であ る。 $\Gamma_{\text{boundary}} + \Gamma_{\text{bulk}}$ を 1/D の関数としてプロットした グラフを図2に示す。図から分かるように、データ は直線上によくのっており、音速 $v \sim 800 \text{ m/sec}$ と評価される。さらに、フォノンの寿命と平均自 由行程を計算したところ、 $\tau_{7x9NW} \sim 4.1$ psec, $\Lambda_{7x9NW} \sim 3.3$ nm, $\tau_{12x12NW} \sim 4.6$ psec, $\Lambda_{12x12NW} \sim 3.7 \text{ nm}$ であった。[2]

[1]多田哲也 他, 第74回応用物理学会秋期学術 講演会 20a-C9-4

[2]V. Poborchii 他, Appl. Phys. Lett. 103, 153104 (2013).